

1/9/1

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014419612 **Image available**

WPI Acc No: 2002-240315/200229

XRPX Acc No: N02-185475

Scanning unit for optical position measuring device, uses
optoelectronic
photodetector with adjacent detector zones coupled via conductor paths
to
evaluation device

Patent Assignee: HEIDENHAIN GMBH JOHANNES (HEIJ)

Inventor: HOLZAPFEL W; LOESCHCKE K; MAYER E J

Number of Countries: 022 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
WO 200184083	A1	20011108	WO 2001DE1672	A	20010427	200229 B
DE 10022619	A1	20011206	DE 1022619	A	20000428	200229
EP 1279004	A1	20030129	EP 2001936033	A	20010427	200310
			WO 2001DE1672	A	20010427	
JP 2003532098	W	20031028	JP 2001581060	A	20010427	200373
			WO 2001DE1672	A	20010427	

Priority Applications (No Type Date): DE 1022619 A 20000428

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

WO 200184083 A1 G 32 G01D-005/26

Designated States (National): JP US

Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT

LU

MC NL PT SE TR

DE 10022619 A1 G01B-011/00

EP 1279004 A1 G G01D-005/26 Based on patent WO 200184083

Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT

LI

LU MC NL PT SE TR

JP 2003532098 W 40 G01D-005/30 Based on patent WO 200184083

Abstract (Basic): WO 200184083 A1

NOVELTY - The scanning unit has a structured optoelectronic
photodetector provided with a number of adjacent radiation-

sensitive

detector zones (I1-I6) formed in a semiconductor substrate, coupled
via

conductor paths (L1-L8) to an evaluation device. Parts of the
conductor

paths extend across the detector zones and are connected to
associated

detector zones or partial detector zones providing equi-phase
scanning

signals.

USE - The scanning unit is used in optical position measuring
device for providing incremental and reference pulse signals.

ADVANTAGE - The detector regions are arranged for optimum use

of

the available surface area of the semiconductor substrate.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a schematic representation of an optoelectronic photodetector with adjacent detector zones.

Detector zones (I1-I6)

Conductor paths (L1-L8)

pp; 32 DwgNo 4/6

Title Terms: SCAN; UNIT; OPTICAL; POSITION; MEASURE; DEVICE;

PHOTODETECTOR;

ADJACENT; DETECT; ZONE; COUPLE; CONDUCTOR; PATH; EVALUATE; DEVICE

Derwent Class: S02; V07

International Patent Class (Main): G01B-011/00; G01D-005/26; G01D-005/30

International Patent Class (Additional): G01D-005/36; H01L-027/144; H01L-031/02; H01L-031/12

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): S02-A03B4; S02-A06C; V07-K05

?



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Offenlegungsschrift
10 DE 100 22 619 A 1

51 Int. Cl. 7:
G 01 B 11/00
G 01 D 5/36
H 01 L 27/144

21 Aktenzeichen: 100 22 619.1
22 Anmeldetag: 28. 4. 2000
43 Offenlegungstag: 6. 12. 2001

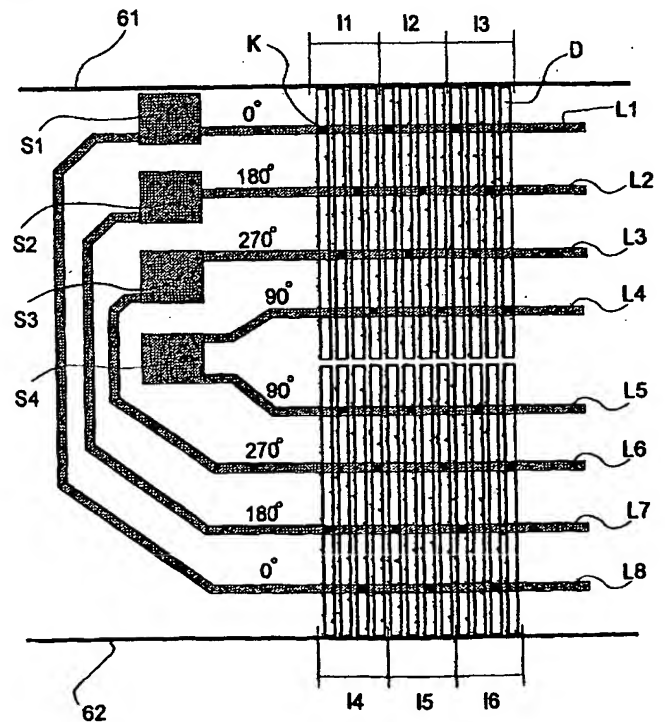
71 Anmelder:
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, 83301 Traunreut,
DE
74 Vertreter:
Maikowski & Ninnemann, Pat.-Anw., 10707 Berlin

72 Erfinder:
Mayer, Elmar J., 83365 Nußdorf, DE; Holzapfel,
Wolfgang, 83119 Obing, DE; Loeschke, Klaus,
12527 Berlin, DE
56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
zu ziehende Druckschriften:
DE 32 29 343 C2
DE 198 43 155 A1
US 44 99 374
WO 99 08 074 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

54 Abtasteinheit für eine optische Positionsmesseinrichtung

57 In einer Abtasteinheit für eine optische Positionsmesseinrichtung mit einem strukturierten optoelektronischen Fotodetektor, der mehrere benachbart zueinander auf einem gemeinsamen Halbleitersubstrat angeordnete strahlungsempfindliche Detektorbereiche D bzw. I1-I6 umfasst, die über Leiterbahnen L1-L8 mit einer Auswerteeinrichtung verbunden sind, sind die Leiterbahnen L1-L8 über die Oberfläche der Detektorbereiche D bzw. I1-I6 geführt und mit zugeordneten Detektorbereichen oder Detektor-Teilbereichen D; I1-I6, die phasengleiche Abtastsignale liefern, verbunden. Dadurch können die Detektorbereiche D bzw. I1-I6 eine maximale Fläche einnehmen und bis an die Seitenkanten 61, 62 des Fotodetektors erstreckt werden (Fig. 4).



DE 100 22 619 A 1

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Abtasteinheit für eine optische Positionsmesseinrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Aus der WO 99/08074 ist eine Abtasteinheit für eine optische Positionsmesseinrichtung bekannt, die neben periodischen Inkrementalsignalen auch mindestens ein Referenzimpulssignal bei einer definierten Referenzposition eines Maßstabes und einer relativ dazu beweglichen Abtasteinheit liefert. Auf den Maßstab ist mindestens ein Referenzmarkierungsfeld in einer Inkrementalteilungsspur integriert angeordnet und die Abtasteinheit umfaßt eine Detektoranordnung, die in Meßrichtung mindestens drei benachbarte, aktive Detektorbereiche aufweist. Zwei der drei Detektorbereiche bilden Referenzimpulssignal-Detektorbereiche und dienen zur Erzeugung eines Referenzimpulssignales, wobei die Relativanordnung der Referenzimpulssignal-Detektorbereiche in Meßrichtung in Abhängigkeit von der Strukturierung des Referenzmarkierungsfeldes auf den Maßstab gewählt ist. Ein zwischen den Referenzimpulssignal-Detektorbereichen angeordneter Detektorbereich dient zur Erzeugung mindestens eines Inkrementalsignales.

[0003] Wie insbesondere der Fig. 3a dieser Druckschrift mit einer Anordnung aktiver Detektorbereiche sowohl für Referenzimpulssignal-Detektorbereiche als auch für Inkrementalsignal-Detektorbereiche zu entnehmen ist, erfolgt die Kontaktierung der verschiedenen aktiven Detektorbereiche an den Stirnseiten der Detektorbereiche und infolge der zahlreichen parallelen Leitungsführungen benötigt die Anordnung seitlich der Detektorbereiche viel Platz auf der Platine bzw. dem Halbleitersubstrat des Fotodetektors, auf dem die aktiven Detektorbereiche und die Kontaktierungs-Leiterbahnen anzuordnen sind. Dieser seitlich der aktiven Detektorbereiche benötigte Platz für die Leiterbahnen kann daher nicht für die aktiven Detektorbereiche auf dem Halbleitersubstrat zur Aufnahme der Detektorbereiche und Leiterbahnen verwendet werden.

[0004] Zur Erzeugung der Inkremental- und Referenzimpulssignale ist es jedoch von besonderer Bedeutung, die strahlungsempfindlichen Detektorbereiche des Fotodetektors möglichst großflächig zu machen, um auf der Empfangsseite der Abtasteinheit möglichst viel im Durchlicht- oder Auflichtverfahren empfangenes Licht einzukoppeln. Dem steht allerdings die Miniaturisierung der optischen Positionsmesseinrichtung entgegen, bei der die Abtasteinheit ein möglichst kleines Volumen beanspruchen soll, was dazu führt, daß für die Detektorbereiche auf dem Substrat eine nur geringe Fläche zur Verfügung steht. Auf dieser Fläche müssen bei einer Relativ- und Absolutmessung sowohl die Inkrementalsignal-Detektorbereiche als auch die Referenzimpuls-Detektorbereiche so angeordnet werden, daß auch unter ungünstigen Bedingungen wie starken Verschmutzungen eine einwandfreie Erfassung und Abgabe von Inkremental- und Referenzimpulssignalen gewährleistet ist.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, die für die Detektorbereiche auf dem Substrat eines Fotodetektors einer Abtasteinheit verfügbare Fläche optimal zu nutzen.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0007] Die erfindungsgemäße Lösung ermöglicht die optimale Nutzung der für die Detektorbereiche auf dem Substrat eines Fotodetektors einer Abtasteinheit verfügbaren Fläche zur Erzeugung von Inkrementalsignalen und ggf. Referenzimpulssignalen, indem die gesamte Substrat- oder Platinenfläche, insbesondere die quer zur Meßrichtung verlaufende Breite des Substrats vollständig für die Detektorbereiche ge-

nutzt werden kann, da die zu den einzelnen Detektorbereichen führenden Leiterbahnen über die Oberfläche der Detektorbereiche geführt und mit den jeweiligen Detektorbereichen verbunden sind. Die optimale Ausnutzung der teuren (Silizium-)Halbleiter-Substratfläche trägt nicht nur einer Minimierung des Fotodetektors Rechnung, sondern reduziert auch die Herstellungskosten.

[0008] Die erfindungsgemäße Lösung weist den besonderen Vorteil auf, daß zur Erzeugung der Abtastsignale die Längserstreckung der Detektorbereiche quer zur Meßrichtung maximal ist, so daß auch unter ungünstigen Bedingungen noch hinreichend Licht eingekoppelt wird.

[0009] Vorzugsweise bestehen die Detektorbereiche aus schmalen, rechteck- oder kreisabschnittsförmigen und strahlungsempfindlichen Streifen, deren Längsseiten im wesentlichen senkrecht zur Messrichtung benachbart zueinander angeordnet sind, und die Leiterbahnen sind im wesentlichen senkrecht zu den Längsseiten der Detektorbereiche geführt.

[0010] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Lösung ist dadurch gekennzeichnet, daß der optoelektronische Fotodetektor auf einem halbleitenden Grundkörper des einen Leitfähigkeitstyps angeordnete, die Detektorbereiche bildende dünne, streifenförmige Schichten des anderen Leitfähigkeitstyps, eine die Vorderseite des Fotodetektors bildende Antireflexionsschicht und eine dazwischen angeordnete Isolationsschicht aufweist und dass an den Verbindungen der Leiterbahnen mit zugeordneten Detektorbereichen Öffnungen in der Antireflexionsschicht zur Herstellung von Kontaktpunkten zwischen den Leiterbahnen und den betreffenden Detektorbereichen vorgesehen sind. Alternativ hierzu kann an den Verbindungen der Leiterbahnen mit zugeordneten Detektorbereichen die Antireflexionsschicht mit den dünnen, streifenförmigen Schichten des anderen Leitfähigkeitstyps verbunden werden, um Kontaktpunkte zum Auskoppeln der in dem betreffenden Detektorbereich gespeicherten Ladung herzustellen.

[0011] Eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lösung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Detektorbereiche periodisch und äquidistant zueinander angeordnet sind, wobei mehrere benachbarte Detektorbereiche eine Gruppe bilden, die zueinander phasenversetzte Abtastsignale liefert, und dass jeweils eine Leiterbahn mit den Detektorbereichen der verschiedenen Gruppen verbunden ist, die phasengleiche Abtastsignale abgeben.

[0012] Über die gruppenweise zusammengefassten Detektorbereiche ist eine sogenannte "Einfeldabtastung" des Massstabes gewährleistet, bei der sämtliche Signalanteile zur Erzeugung der Abtastsignale stets nur aus einer Teilungsperiode des abgetasteten Massstabes stammen. Eine derartige Anordnung ist insbesondere hinsichtlich der Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen des Massstabes vorteilhaft, da die phasenverschobenen Signalanteile, die zur Erzeugung der Abtastsignale beitragen, allesamt gleich beeinflusst werden.

[0013] Vorzugsweise bilden jeweils vier aktive Detektorbereiche eine Gruppe, die vier jeweils um 90° phasenversetzte Abtastsignale liefert, wobei mindestens zwei Gruppen aktiver Detektorbereiche in Messrichtung nebeneinander angeordnet und vier parallele Leiterbahnen mit den Detektorbereichen der Gruppen verbunden sind, die phasengleiche Abtastsignale abgeben.

[0014] Des weiteren können vorteilhaft mehrere Gruppen aktiver Detektorbereiche in Messrichtung hintereinander und nebeneinander angeordnet werden, wobei eine dem Phasenversatz entsprechende Anzahl Leiterbahnen mit den Detektorbereichen der in Messrichtung hintereinander angeordneten Gruppen verbunden ist, die phasengleiche Abtastsignale liefern. Die phasengleiche Abtastsignale erfassen-

den Leiterbahnen der in Messrichtung parallel zueinander angeordneten Gruppen sind dabei miteinander verbunden.

[0015] Die Verbindung der phasengleichen Abtastsignale erfassenden Leiterbahnen der in Messrichtung parallel zueinander angeordneten Gruppen kann insbesondere auf der Rückseite des strukturierten Fotodetektors angeordnet werden.

[0016] Für den Betrieb einer derartigen Abtasteinheit weist der strukturierte Fotodetektor in Messrichtung vorzugsweise mehrere hintereinander angeordnete Gruppen mit jeweils mehreren Detektorbereichen auf, wobei der eine Teil der Gruppen Referenzimpuls-Detektorbereiche zur Erzeugung von Referenzimpuls-Signalen und der andere Teil der Gruppen Inkrementalsignal-Detektorbereiche zur Erzeugung von Inkrementalsignalen enthält. Die Referenzimpuls-Detektorbereiche sind mit Referenzimpuls-Leiterbahnen und die Inkrementalsignal-Detektorbereiche, die phasengleiche Ausgangssignale liefern, sind mit jeweils einer Inkrementalsignal-Leiterbahn verbunden.

[0017] Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lösung ist dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Inkrementalsignal-Leiterbahnen über die strahlungsempfindlichen Oberflächen der Inkrementalsignal-Detektorbereiche geführt und jeweils mit phasengleiche Ausgangssignale liefernden Inkrementalsignal-Detektorbereichen verbunden sind.

[0018] Weiterhin können zwei Gruppen Inkrementalsignal-Detektorbereiche mit jeweils zwei in Messrichtung hintereinander und nebeneinander angeordneten Gruppen von phasengleiche Ausgangssignale liefernden Detektorbereichen und eine zwischen den beiden Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen eine Gruppe von Referenzimpuls-Detektorbereichen vorgesehen werden, während die Inkrementalsignal-Leiterbahnen jeweils zu den Stirnseiten des strukturierten Fotodetektors geführt sind. Dabei können die Referenzimpuls-Leiterbahnen zwischen den in Messrichtung nebeneinander angeordneten Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen angeordnet werden.

[0019] Zur Erzeugung der Referenzimpulssignale können die die Taktsignale der Referenzimpuls-Detektorbereiche erfassenden Referenzimpuls-Leiterbahnen zu der einen Stirnseite zwischen den in Messrichtung nebeneinander angeordneten Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen dieser Seite und die die Gegentaktsignale der Referenzimpuls-Detektorbereiche erfassenden Referenzimpuls-Leiterbahnen zu der anderen Stirnseite zwischen den in Messrichtung nebeneinander angeordneten Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen dieser Seite geführt werden.

[0020] Alternativ können die die Taktsignale und die die Gegentaktsignale der Referenzimpuls-Detektorbereiche erfassenden Referenzimpuls-Leiterbahnen abschnittsweise übereinander angeordnet zwischen den in Messrichtung nebeneinander angeordneten Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen der einen Seite geführt werden.

[0021] Da die Leiterbahnen mit einer Isolationsschicht zumindest auf der den Detektorbereichen zugewandten Seite versehen sind, können die Referenzimpuls-Leiterbahnen zumindest teilweise über die einander gegenüberliegenden Schmalseiten der in Messrichtung nebeneinander angeordneten Gruppen der Inkrementalsignal-Detektorbereiche geführt werden.

[0022] Schließlich können die in Messrichtung jeweils hintereinanderliegenden Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen mit jeweils einer Inkrementalsignal-Leiterbahn für phasengleiche Ausgangssignale verbunden und die Inkrementalsignal-Leiterbahnen über die Referenzimpuls-Detektorbereiche geführt werden.

[0023] Anhand von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen soll der der Erfindung zugrunde liegende Gedanke näher erläutert werden. Es zeigen:

[0024] Fig. 1 bis 3 eine optische Positionsmeßeinrichtung mit Abtasteinheit und Maßstab sowie eine vergrößerte Draufsicht auf eine Platine und eine Abtastplatte der Abtasteinheit;

[0025] Fig. 4 eine schematische Darstellung mehrerer hintereinander und nebeneinander angeordneter Gruppen von Detektorbereichen zur Erzeugung von Inkrementalsignalen mit Leiterbahnen, die Detektorbereiche mit phasengleichen Abtastsignalen kontaktieren;

[0026] Fig. 5 eine schematische Darstellung von neben- und hintereinander angeordneten Gruppen von Inkrementalsignal- und Referenzimpuls-Detektorbereichen sowie Leiterbahnen, die phasen- und taktgleiche Abtastsignale liefernde Detektorbereiche zusammenfassen und

[0027] Fig. 6 eine schematisch-perspektivische Darstellung eines Fotodetektors mit einer phasengleiche Abtastsignale abgebende Detektorbereiche zusammenfassende und über die Detektorbereiche gelegten Leiterbahn.

[0028] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine optische Positionsmesseinrichtung, die eine Abtasteinheit 1 und einen relativ zur Abtasteinheit 1 in Messrichtung x beweglichen Maßstab 2 enthält. Die Abtasteinheit 1 umfasst einen sendeseitigen Teil, der eine Lichtquelle 4, die auf einer in Draufsicht in Fig. 2 dargestellten Platine 3, vorzugsweise in Form einer auf der Oberfläche der Platine 3 befestigten lichtemittierenden Diode ausgebildet ist, und eine der Lichtquelle 4 zugeordnete Kollimatoroptik 5 in Form einer Zylinderlinse, die mit ihrer ebenen Fläche der Lichtquelle 4 zugewandt auf einem mit der Platine 3 verbundenen Aufbau 30 befestigt ist.

[0029] Im empfangsseitigen Teil der Abtasteinheit 1 ist auf der Platine 3 ein Fotodetektor oder Fotosensor 6 mit verschiedenen aktiven, strahlungsempfindlichen Detektorbereichen D (Fig. 2) vorgesehen, zwischen denen jeweils inaktive, strahlungsunempfindliche Bereiche angeordnet sind. In geringem Abstand zur Platine 3 ist eine in Fig. 3 in Draufsicht dargestellte Abtastplatte 7 angeordnet, die in Messrichtung x nebeneinander angeordnet eine Sendestruktur 71 und eine Abtaststruktur 72 enthält.

[0030] Beabstandet zur Abtasteinheit 1 ist der Maßstab 2 angeordnet, der eine sich in Messrichtung x erstreckende Messteilung 20 enthält, deren optische Abtastung bei der Relativbewegung zwischen Abtasteinheit 1 und Maßstab 2 Abtastsignale liefert. Der in Fig. 1 schematisch dargestellte Strahlengang S geht von der Lichtquelle 4 aus und wird mittels der Zylinderlinse 5 durch eine in der Platine 3 vorgesehene, sich in Messrichtung x erstreckende Öffnung 31 zur Abtastplatte 7 und der darauf angeordneten Sendestruktur 71 reflektiert und gelangt durch die Sendestruktur 71 zu der auf dem Maßstab 2 angeordneten Meßteilung 20, von der der Messstrahl S durch die Abtaststruktur 72 zu dem vorzugsweise auf einem Halbleitersubstrat angeordneten Fotodetektor 6 mit den darauf vorgesehenen strahlungsempfindlichen Detektorbereichen D reflektiert wird.

[0031] Die in Fig. 1 dargestellte optische Positionsmesseinrichtung arbeitet im Auflicht, so dass die auf dem Maßstab 2 vorgesehene Messteilung reflektierende und nichtreflektierende Teilbereiche aufweist, die den Strahlengang S reflektieren bzw. nicht reflektieren. Bei einer im Durchlicht arbeitenden optischen Positionsmesseinrichtung befindet sich der Maßstab 2 zwischen dem sendeseitigen Teil der Abtasteinheit 1 und deren empfangsseitigem Teil, so dass der von der Lichtquelle 4 ausgehende Strahlengang über die Zylinderlinse 5 und die Sendestruktur 71 der Abtastplatte zur Messteilung 20 des Maßstabes 2 und durch die Messteilung

20 hindurch über die Sendestruktur 71 zum Fotodetektor 6 der Abtasteinheit 1 gelangt. In diesem Falle sind die auf dem Maßstab 2 vorgesehenen Abtastfelder der Messteilung 20 für die verwendete Lichtwellenlänge durchlässig und nicht-durchlässig ausgebildet.

[0032] Um bei einer oder mehreren definierten Relativpositionen der zueinander beweglichen Teile der optischen Positionsmeßeinrichtung einen exakten Absolutbezug der Positionsmessung herzustellen, werden neben den Inkrementalsignalen bezüglich des Relativversatzes auch sogenannte Referenzimpulssignale benötigt, zu deren Erzeugung auf Seiten des Maßstabes der jeweiligen Positionsmeßeinrichtung an einer oder mehreren Positionen Referenzmarkierungsfelder angeordnet sind. Die Abtasteinheit einer derartigen Positionsmeßeinrichtung bietet damit die Möglichkeit, bei der zu detektierenden Relativposition von Maßstab und Abtasteinheit ein entsprechendes Referenzimpulssignal zu erzeugen, das in der nachgeordneten Auswerteeinrichtung geeignet verarbeitet wird.

[0033] Zur Erfassung der Relativ- und Absolutposition von Abtasteinheit und Maßstab, die beispielsweise in Werkzeugmaschinen zur Erfassung der relativen und absoluten Position von Werkstück und Werkzeug eingesetzt werden, sind daher entsprechende Referenzmarkierungsfelder auf dem Maßstab und Referenzimpuls-Detektorbereiche R sowie Inkrementalsignal-Detektorbereiche I als Detektorbereiche D auf dem Substrat 3 des Fotodetektors 6 vorgesehen.

[0034] Weitere Einzelheiten zur Aufgabe, Funktion und Gestaltung der Inkrementalteilungsspur und der Referenzmarkierungsfelder auf dem Maßstab sowie der Inkrementalsignal-Detektorbereiche und Referenzimpuls-Detektorbereiche des Fotodetektors zur Erzeugung von Inkremental- und Referenzimpulssignalen sind der vorstehend genannten WO 99/08074 zu entnehmen. Zur Detektion der vom Maßstab 2 kommenden Strahlenbündel ist in den Ausführungsbeispielen der Fig. 4 bis 6 eine strukturierte Detektoranordnung vorgesehen, die aus mehreren aktiven, d. h. strahlungsempfindlichen Detektorbereichen besteht, die jeweils eine schmale Streifenform aufweisen und in Meßrichtung x periodisch und benachbart zueinander angeordnet sind. Hierzu wird ein geeignetes Halbleitersubstrat derart strukturiert, daß auf dem Substrat eine Reihe strahlungsempfindlicher Detektorbereiche resultiert. Die verschiedenen aktiven Detektorbereiche liefern im Fall der Relativbewegung von Maßstab und Abtasteinheit jeweils Signalanteile, die zur Erzeugung phasenversetzter Inkrementalsignale herangezogen werden.

[0035] Die in Fig. 4 schematisch dargestellte Draufsicht auf einen Fotodetektor zeigt mehrere Gruppen hintereinander und nebeneinander angeordneter Detektorbereiche 11 bis 16 zur Erfassung von Abtastsignalen, die als Inkrementalsignale einer Auswerteeinrichtung zugeführt werden. Vier Inkrementalsignal-Detektorbereiche bilden dabei jeweils eine Gruppe 11 bis 16, wobei jeweils ein Inkrementalsignal-Detektorbereich ein Teil-Inkrementalsignal mit der Phasenlage 0°, ein Inkrementalsignal-Detektorbereich ein Teil-Inkrementalsignal mit der Phasenlage 180°, ein Inkrementalsignal-Detektorbereich ein Teil-Inkrementalsignal mit der Phasenlage 90° und ein Inkrementalsignal-Detektorbereich ein Teil-Inkrementalsignal mit der Phasenlage 270° liefert.

[0036] Selbstverständlich kann auch eine andere Relativanordnung der verschiedenen Inkrementalsignal-Detektorbereiche gewählt werden, so daß diese dann Teil-Inkrementalsignale mit anderen relativen Phasenlagen als in dem in Fig. 4 dargestellten Beispiel liefern. Beispielsweise wäre eine Anordnung der Inkrementalsignal-Detektorbereiche möglich, die Signale mit der Phasenlage 0°, 120°, 240°...

liefern. Referenzimpulssignal-Detektorbereiche weist diese Anordnung nicht auf.

[0037] Die im Beispiel von Fig. 4 gezeigte Anordnung der aktiven Detektorbereiche hat zur Folge, daß die innerhalb einer Teilungsperiode liegenden, benachbarten aktiven Detektorbereiche einer Vierergruppe 11 bis 16 bei der optischen Abtastung der Inkrementalteilung vier jeweils um 90° phasenversetzte Abtastsignale liefern. Über die gezeigte Anordnung der Detektorbereiche ist somit eine sogenannte "Einfeldabtastung" des Maßstabes gewährleistet, bei der sämtliche Signalanteile zur Erzeugung der Inkrementalsignale stets nur aus einer Teilungsperiode des abgetasteten Maßstabes stammen. Eine derartige Abtastung ist insbesondere hinsichtlich der Unempfindlichkeit gegenüber großflächigen Verschmutzungen des Maßstabes vorteilhaft, da die phasenverschobenen Signalanteile, die zur Erzeugung der Abtastsignale beitragen, allesamt gleich beeinflusst werden.

[0038] In Fig. 4 sind schematisch die Seitenränder 61, 62 der aktiven Fläche des Fotodetektors 6 gemäß Fig. 1 dargestellt, die die Seitenränder des Halbleitersubstrats bilden, auf dem die strahlungsempfindlichen Detektorbereiche strukturiert ausgebildet sind. Üblicherweise wird die Länge der aktiven Detektorbereiche senkrecht zur Meßrichtung x dadurch begrenzt, daß die mit den Detektorbereichen verbundenen Leiterbahnen zwischen den Stirnseiten der Detektorbereiche und den Seitenkanten 61, 62 geführt werden bzw. von den Stirnseiten der Detektorbereiche über die Seitenkanten zur Platine bzw. zur Rückseite des Halbleitersubstrats geführt werden müssen.

[0039] Demgegenüber werden in der erfindungsgemäßen Ausführungsform die Leiterbahnen L1 bis L8 quer zur Längserstreckung der Detektorbereiche D über die Oberflächen der Detektorbereiche D geführt. Dabei weisen die Leiterbahnen L1 bis L8 zumindest auf der der Oberseite der Detektorbereiche D zugewandten Seite eine Isolation auf, die nur an vorgegebenen Punkten K zur Kontaktierung mit vorgegebenen Detektorbereichen durchbrochen wird. Auf diese Weise werden phasengleiche Abtastsignale liefernde Detektorbereiche D2 der einzelnen Gruppen I1 bis I6 zusammengefaßt und über Kontakte S1 bis S4 zur Signalverarbeitung an die Auswerteeinrichtung weitergeleitet.

[0040] Das in Fig. 4 dargestellte Ausführungsbeispiel zeigt die Zusammenfassung von vier, jeweils um 90° phasenversetzte Abtastsignale, die aus der Verbindung der Leiterbahnen L1 bis L8 mit den jeweiligen Detektorbereichen D der hinter- und nebeneinander angeordneten Gruppen von Detektorbereichen I1 bis I6 resultieren.

[0041] Wie der Darstellung gemäß Fig. 4 zu entnehmen ist, bewirkt die Führung der Leiterbahnen L1 bis L8 quer über die Längserstreckungen der Detektorbereiche D eine optimale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Fläche des Fotodetektors, indem die Detektorbereiche D bis unmittelbar an die Seitenkanten 61, 62 des Fotodetektors geführt werden können.

[0042] Eine andere Form einer strukturierten Detektoranordnung ist in Fig. 5 als Draufsicht auf beispielsweise ein Halbleitersubstrat dargestellt, das die aktiven Detektorbereiche neben den inaktiven Bereichen ausbildet. In dieser Ausführungsform sind sowohl Inkrementalsignale als auch Referenzimpulssignale als Abtastsignale liefernde Detektorbereiche vorgesehen, so daß diese Anordnung geeignet ist, sowohl die relative Stellung zweier relativ zueinander bewegter Systeme als auch eine absolute Position der relativ zueinander bewegten Systeme zu erfassen.

[0043] Die Inkrementalsignale werden in zwei Inkrementalsignal-Detektorbereichen erfaßt, die durch einen Referenzimpulssignal-Detektorbereich voneinander getrennt sind. Die Inkrementalsignal-Detektorbereiche I10, I20, I30

und I40 werden durch gruppenweise zusammengefaßte Teilbereiche gebildet, die in Meßrichtung x hintereinander angeordnet sind. Jeweils phasengleiche Abtastsignale liefernde Detektorbereiche werden mittels quer über die Längserstreckung der Detektorbereiche und damit in Meßrichtung x verlaufender Leiterbahnen L11 bis L28 kontaktiert.

[0044] Die Inkrementalsignal-Detektorbereiche I10, I20, I30, I40 liefern jeweils um 90° phasenversetzte Inkrementalsignale und sind dementsprechend über die Leiterbahnen L11 bis L28 durch entsprechende Kontaktpunkte mit den entsprechenden Detektorbereichen zusammengefaßt. So liefern beispielsweise die Leiterbahnen L11, L17, L21 und L27 die Phasenlagen 0°, während die Leiterbahnen L12, L18, L22 und L28 die um 90° phasenversetzten Phasenlagen von 270° über jeweils vier hintereinander angeordnete Detektorgruppen eines Detektorbereichs liefern. Dabei erfaßt beispielsweise die Leiterbahn L11 am Kontaktpunkt K1 den Detektorbereich I101, während die Leiterbahn L28 am Kontaktpunkt K2 den Detektorbereich I413 erfaßt usw.

[0045] Der zwischen den Inkrementalsignal-Detektorbereichen I10, I20, I30, I40 angeordnete Referenzimpuls-signal-Detektorbereich weist mehrere in Meßrichtung hintereinander angeordnete identische Referenzimpuls-Detektorbereiche R1 bis R8 auf, die im Unterschied zu den gruppenweise nebeneinander angeordneten Inkrementalsignal-Detektorbereichen durchgehend von der einen zur anderen Seitenkante der Detektoranordnung ausgebildet sind. Zur Erzeugung der Referenzimpulssignale werden die Referenzimpuls-Detektorbereiche R1 bis R8 mit einer Takt- und Gegentaktleitung L31, L32 kontaktiert, wobei jeweils ein Detektorbereich R1 bis R8 übersprungen wird, so daß jeder zweite Detektorbereich R1 bis R8 entweder mit der Taktleitung L31 oder der Gegentaktleitung L32 verbunden ist.

[0046] Analog zur Anordnung der Leiterbahnen gemäß Fig. 4 sind auch bei dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel die Leiterbahnen L11 bis L28 quer über die Detektorbereiche der Inkrementalsignal-Detektorbereiche I10, I20, I30, I40 zu den Stirnseiten der Detektoranordnung geführt. Da die Leiterbahnen L11 bis L28 eine insgesamt geringe strahlungsempfindliche Fläche bei der Querung der Detektorbereiche belegen, kann abweichend von der in Fig. 5 dargestellten Konfiguration auch jeweils eine einzelne Leiterbahn über sämtliche (Inkrementalsignal- und Referenzimpuls-)Detektorbereiche geführt werden, um die phasenversetzten Abtastsignale von 0°, 270°, 180° und 90° der in Meßrichtung hintereinander angeordneten Gruppen durch Kontaktgabe mit den entsprechenden Inkrementalsignal-Detektorbereichen zu erfassen. Dies bedingt zwar eine Führung der Leiterbahnen über die Referenzimpuls-Detektorbereiche R1 bis R8 hinüber, würde aber aufgrund der großflächigen Referenzimpuls-Detektorbereiche eine nur geringfügige Beeinträchtigung der Referenzimpuls-Detektorbereiche bedeuten.

[0047] Die Takt- und Gegentaktleitung L31, L32 für die Referenzimpuls-Detektorbereiche R1 bis R8 ist in dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel zwischen die in Meßrichtung x nebeneinander liegenden Inkrementalsignal-Detektorbereiche I10, I20 bzw. I30, I40 hindurchgeführt. Diese Konfiguration nutzt den ohnehin für die Trennung der nebeneinander angeordneten Inkrementalsignal-Detektorbereiche I10, I20 bzw. I30, I40 erforderlichen Spalt aus, so daß keine aktive, d. h. strahlungsempfindliche Fläche beansprucht wird. Durch die Anordnung der Takt- und Gegentaktleitung L31, L32 zwischen den nebeneinander angeordneten Inkrementalsignal-Detektorbereichen I10, I20 sowie I30, I40 ist es möglich, die Stirnseiten sowohl der Inkrementalsignal-Detektorbereiche I10, I20, I30, I40 als auch der Referenzimpuls-Detektorbereiche R1 bis R8 bis unmittelbar

an die Seitenkanten der Detektoranordnung zu führen und somit eine maximale aktive, d. h. strahlungsempfindliche Fläche für die Detektorbereiche vorzusehen.

[0048] Je nach Konfiguration und Baugröße des Fotodetektors sind aber auch abweichend von den Darstellungen in den Fig. 4 und 5 unterschiedliche Führungen der Leiterbahnen möglich. So kann beispielsweise die Takt- und Gegentaktleitung L31, L32 in der Anordnung gemäß Fig. 5 auch an einer Seitenkante der Detektoranordnung entlang geführt werden. Dies schränkt allerdings die Möglichkeit ein, die Stirnseiten sowohl der Inkrementalsignal-Detektorbereiche als auch der Referenzimpuls-Detektorbereiche bis unmittelbar an die Seitenkanten der Detektoranordnung zu führen.

[0049] Fig. 6 zeigt eine schematisch-perspektivische Ansicht eines optoelektronischen Fotodetektors bzw. Fotosensors mit einer über die Oberfläche des Fotodetektors 6 geführten Leiterbahn L, die an zwei Kontaktierungsstellen K3, K4 mit aktiven, d. h. strahlungsempfindlichen Detektorbereichen des Fotodetektors 6 verbunden ist.

[0050] Der halbleitende Grundkörper des optoelektronischen Fotodetektors 6 besteht beispielsweise aus Silizium und umfaßt eine breite n-leitende Schicht 60 (300 µm bis 400 µm dick), an deren Oberfläche sich mehrere äquidistant verteilt angeordnete, wesentlich dünnere p-leitende Schichten 61 (ca. 0,55 µm dick) erstrecken. Zwischen der n-leitenden Schicht 60 und den p-leitenden Schichten 61 bilden sich Raumladungszone (Verarmungszonen) aus, die als Sperrschichten wirken.

[0051] Die Vorderseite des optoelektronischen Fotodetektors 6 ist mit einer metallischen Antireflexionsschicht 63 versehen und wird durch eine isolierende Schicht 62 strukturiert, die z. B. aus Siliziumdioxid als Isolator bestehen können. Zwischen den isolierenden oder inaktiven Bereichen 65 erstrecken sich so die aktiven, strahlungsempfindlichen Detektorbereiche 64 bzw. D.

[0052] Auf die aktiven, strahlungsempfindlichen Detektorbereiche 64 bzw. D auftreffende elektromagnetische Strahlung gelangt durch die p-leitenden Schichten 61 in die Raumladungszone und wird dort zu einem großen Teil absorbiert. Dabei entstehen in der Raumladungszone Elektron-Lochpaare. Das Raumladungsfeld trennt diese Trägerpaare; Elektronen fließen zur n-, Löcher zur p-Seite. Um diesen Fotostrom, der ein Maß für die einfallende Strahlungsleistung ist, messen zu können, wird der optoelektronische Photodetektor 6 in eine geeignete elektrische Schaltung integriert.

[0053] Die senkrecht zur Längserstreckung der aktiven Detektorbereiche 64 und über deren Oberfläche verlegte oder anderweitig aufgetragene Leiterbahn L besteht aus einem elektrisch leitfähigen Teil 8 sowie einer Isolations-schicht 9, die zumindest zwischen dem elektrisch leitfähigen Teil 8 und der Oberfläche des optoelektronischen Fotodetektors 6 vorgesehen ist. Die Isolations-schicht 9 bewirkt, daß nur an den gewünschten Stellen die Leiterbahn L die entsprechenden Detektorbereiche D des Fotodetektors 6 kontaktiert, um beispielsweise phasengleiche Abtastsignale zu erfassen und an eine Auswerteinrichtung weiterzuleiten.

[0054] An den Kontaktierungspunkten K3, K4, an denen die Leiterbahn L mit den entsprechenden Detektorbereichen 64 bzw. D des Fotodetektors 6 verbunden werden soll, ist eine Öffnung in der Antireflexionsschicht 63 vorgesehen bzw. wie in Fig. 6 dargestellt, die Antireflexionsschicht 63 soweit an den Stellen 66 abgesenkt, daß sie unter Überbrückung der Isolations-schicht 62 die p-leitende Schicht 61 kontaktiert und dadurch die entsprechende Ladung zur Erzeugung eines Abtastsignals ausgekoppelt werden kann.

[0055] Die Verbindung der Leiterbahn L mit den entsprechenden Detektorbereichen 64 an den Kontaktpunkten K3, K4 kann durch entsprechendes Entfernen der Isolations-

schicht 9 oder mittels Durchkontaktierung erfolgen. Beispielsweise kann der elektrisch leitende Teil 8 der Leiterbahn L an den Kontaktpunkten K3, K4 mittels eines Laserstrahls mit der Oberfläche der Antireflexionsschicht 63 bzw. abgesenkten Oberfläche 66 des betreffenden Detektorbereichs D leitfähig verbunden werden.

[0056] Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf die vorstehend angegebenen bevorzugten Ausführungsbeispiele, sondern es ist eine Anzahl von Varianten denkbar, welche von der in der Zeichnung und Beschreibung dargestellten Lösung auch bei grundsätzlich andersgearteten Ausführungen Gebrauch macht.

Patentansprüche

1. Abtasteinheit für eine optische Positionsmesseinrichtung mit einem strukturierten optoelektronischen Fotodetektor, der mehrere benachbart zueinander auf einem gemeinsamen Halbleitersubstrat angeordnete strahlungsempfindliche Detektorbereiche umfasst, die über Leiterbahnen mit einer Auswerteinrichtung verbunden sind, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest ein Teil der Leiterbahnen (L; L1-L8; L11-L28; L31, L32) über die Oberfläche der Detektorbereiche (D; I1-I6; I10, I11, I20, I21; R1-R8) geführt und mit zugeordneten Detektorbereichen oder Detektor-Teilbereichen (D; I1-I6; I10, I11, I20, I21; R1-R8) verbunden ist.
2. Abtasteinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektorbereiche (D; I1-I6; I10, I11, I20, I21; R1-R8) aus schmalen, rechteck- oder streifenförmigen und strahlungsempfindlichen Streifen bestehen, deren Längsseiten im wesentlichen senkrecht zur Messrichtung (x) benachbart zueinander angeordnet sind, und dass die Leiterbahnen (L; L1-L8; L11-L28; L31, L32) im wesentlichen senkrecht zu den Längsseiten der Detektorbereiche (D; I1-I6; I10, I11, I20, I21; R1-R8) geführt sind.
3. Abtasteinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der optoelektronische Fotodetektor (6) auf einem halbleitenden Grundkörper (60) des einen Leitfähigkeitstyps angeordnete, die Detektorbereiche bildende dünne, streifenförmige Schichten des anderen Leitfähigkeitstyps (61), eine die Vorderseite des Fotodetektors (6) bildende Antireflexionsschicht (63) und eine dazwischen angeordnete Isolationsschicht (62) aufweist und dass an den Verbindungen der Leiterbahnen (L; L1-L8; L11-L28; L31, L32) mit zugeordneten Detektorbereichen (D; I1-I6; I10, I11, I20, I21; R1-R8) Öffnungen in der Antireflexionsschicht (63) vorgesehen sind.
4. Abtasteinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der optoelektronische Fotodetektor (6) auf einem halbleitenden Grundkörper (60) des einen Leitfähigkeitstyps angeordnete, die Detektorbereiche bildende dünne, streifenförmige Schichten des anderen Leitfähigkeitstyps (61), eine die Vorderseite des Fotodetektors (6) bildende Antireflexionsschicht (63) und eine dazwischen angeordnete Isolationsschicht (62) aufweist und dass an den Verbindungen der Leiterbahnen (L; L1-L8; L11-L28; L31, L32) mit zugeordneten Detektorbereichen (D; I1-I6; I10, I11, I20, I21; R1-R8) die Antireflexionsschicht (63) mit den dünnen, streifenförmigen Schichten (61) des anderen Leitfähigkeitstyps verbunden ist.
5. Abtasteinheit nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektorbereiche (D; I1-I6; I10, I11, I20, I21; R1-R8)

periodisch zueinander angeordnet sind, wobei mehrere benachbarte Detektorbereiche eine Gruppe (I1-I6; I10, I11, I20, I21; R1-R8) bilden, die zueinander phasenversetzte Abtastsignale liefert, und dass jeweils eine Leiterbahn (L; L1-L8; L11-L28; L31, L32) mit den Detektorbereichen (D; I1-I6; I10, I11, I20, I21; R1-R8) der verschiedenen Gruppen verbunden ist, die phasengleiche Abtastsignale abgeben.

6. Abtasteinheit nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass vier aktive Detektorbereiche eine Gruppe (I1-I6; I10, I11, I20, I21) bilden, die vier jeweils um 90° phasenversetzte Abtastsignale liefert, dass mindestens zwei Gruppen aktiver Detektorbereiche (I1-I6; I10, I11, I20, I21) in Messrichtung (x) nebeneinander angeordnet sind und dass vier parallele Leiterbahnen (L1-L8; L11-L28) mit den Detektorbereichen der Gruppen (I1-I6; I10, I11, I20, I21) verbunden sind, die phasengleiche Abtastsignale abgeben.

7. Abtasteinheit nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Gruppen aktiver Detektorbereiche (I1-I6; I10, I11, I20, I21) in Messrichtung (x) hintereinander und nebeneinander angeordnet sind, dass eine dem Phasenversatz entsprechende Anzahl Leiterbahnen (L1-L8; L11-L28) mit den Detektorbereichen der in Messrichtung (x) hintereinander angeordneten Gruppen (I1-I6; I10, I11, I20, I21) verbunden ist, die phasengleiche Abtastsignale liefern, und dass die phasengleiche Abtastsignale erfassenden Leiterbahnen (L1-L8; L11-L28) der in Messrichtung (x) parallel zueinander angeordneten Gruppen (I1-I6; I10, I11, I20, I21;) miteinander verbunden sind.

8. Abtasteinheit nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung der phasengleiche Abtastsignale erfassenden Leiterbahnen (L1-L8; L11-L28) der in Messrichtung (x) parallel zueinander angeordneten Gruppen (I1-I6; I10, I11, I20, I21) auf der Rückseite des strukturierten Fotodetektors (6) angeordnet ist.

9. Abtasteinheit nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der strukturierte Fotodetektor (6) in Messrichtung (x) mehrere hintereinander angeordnete Gruppen (D; I1-I6; I10, I11, I20, I21; R1-R8) mit jeweils mehreren Detektorbereichen (D) aufweist, wobei der eine Teil der Gruppen Referenzimpuls-Detektorbereiche (R1-R8) zur Erzeugung von Referenzimpuls-Signalen und der andere Teil der Gruppen Inkrementalsignal-Detektorbereiche (I1-I6; I10, I11, I20, I21) zur Erzeugung von Inkrementalsignalen aufweist und dass die Referenzimpuls-Detektorbereiche (R1-R8) mit Referenzimpuls-Leiterbahnen (L31, L32) und die Inkrementalsignal-Detektorbereiche (I1-I6; I10, I11, I20, I21), die phasengleiche Ausgangssignale liefern, mit jeweils einer Inkrementalsignal-Leiterbahn (L1-L8; L11-L28) verbunden sind.

10. Abtasteinheit nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Inkrementalsignal-Leiterbahnen (L1-L8; L11-L28) über die strahlungsempfindlichen Oberflächen der Inkrementalsignal-Detektorbereiche (I1-I6; I10, I11, I20, I21) geführt und jeweils mit phasengleiche Ausgangssignale liefernden Inkrementalsignal-Detektorbereichen (I1-I6; I10, I11, I20, I21) verbunden sind.

11. Abtasteinheit nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Gruppen Inkrementalsignal-Detektorbereiche (I10, I11, I20, I21) mit jeweils zwei in Messrichtung (x) hintereinander und nebeneinander angeordneten Gruppen von phasengleiche Aus-

gangssignale liefernden Detektorbereichen (I10, I11 bzw. I20, I21) und eine zwischen den beiden Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen (I10, I11, I20, I21) eine Gruppe von Referenzimpuls-Detektorbereichen (R1-R8) vorgesehen ist, und dass die Inkrementalsignal-Leiterbahnen (L11-L28) jeweils zu den Stirnseiten des strukturierten Fotodetektors (6) geführt sind.

12. Abtasteinheit nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Referenzimpuls-Leiterbahnen (R1-R8) zwischen die in Messrichtung nebeneinander angeordneten Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen (I10, I11, I20, I21) geführt sind.

13. Abtasteinheit nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die die Taktsignale der Referenzimpuls-Detektorbereiche (R1-R8) erfassende Referenzimpuls-Leiterbahn (L31) zu der einen Stirnseite zwischen den in Messrichtung (x) nebeneinander angeordneten Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen (I10, I11) dieser Seite und die die Gegentaktsignale der Referenzimpuls-Detektorbereiche (R1-R8) erfassende Referenzimpuls-Leiterbahn (L32) zu der anderen Stirnseite zwischen den in Messrichtung (x) nebeneinander angeordneten Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen (I20, I21) dieser Seite geführt sind.

14. Abtasteinheit nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die die Taktsignale und die die Gegentaktsignale der Referenzimpuls-Detektorbereiche (R1-R8) erfassenden Referenzimpuls-Leiterbahnen L31, L32) abschnittsweise übereinander angeordnet zwischen den in Messrichtung (x) nebeneinander angeordneten Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen (I10, I11 bzw. I20, I21) der einen oder anderen Seite geführt sind.

15. Abtasteinheit nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Referenzimpuls-Leiterbahnen (L31, L32) zumindest teilweise über die einander gegenüberliegenden Schmalseiten der in Messrichtung (x) nebeneinander angeordneten Gruppen der Inkrementalsignal-Detektorbereiche (I10, I11, I20, I21) geführt sind.

16. Abtasteinheit nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die in Messrichtung (x) jeweils hintereinanderliegenden Gruppen von Inkrementalsignal-Detektorbereichen (I10, I11, I20, I21) mit jeweils einer Inkrementalsignal-Leiterbahn (L11-L28) für phasengleiche Ausgangssignale verbunden sind und dass die Inkrementalsignal-Leiterbahnen (L11-L28) über die Referenzimpuls-Detektorbereiche (R1-R8) geführt sind.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen

55

60

65

Fig. 4

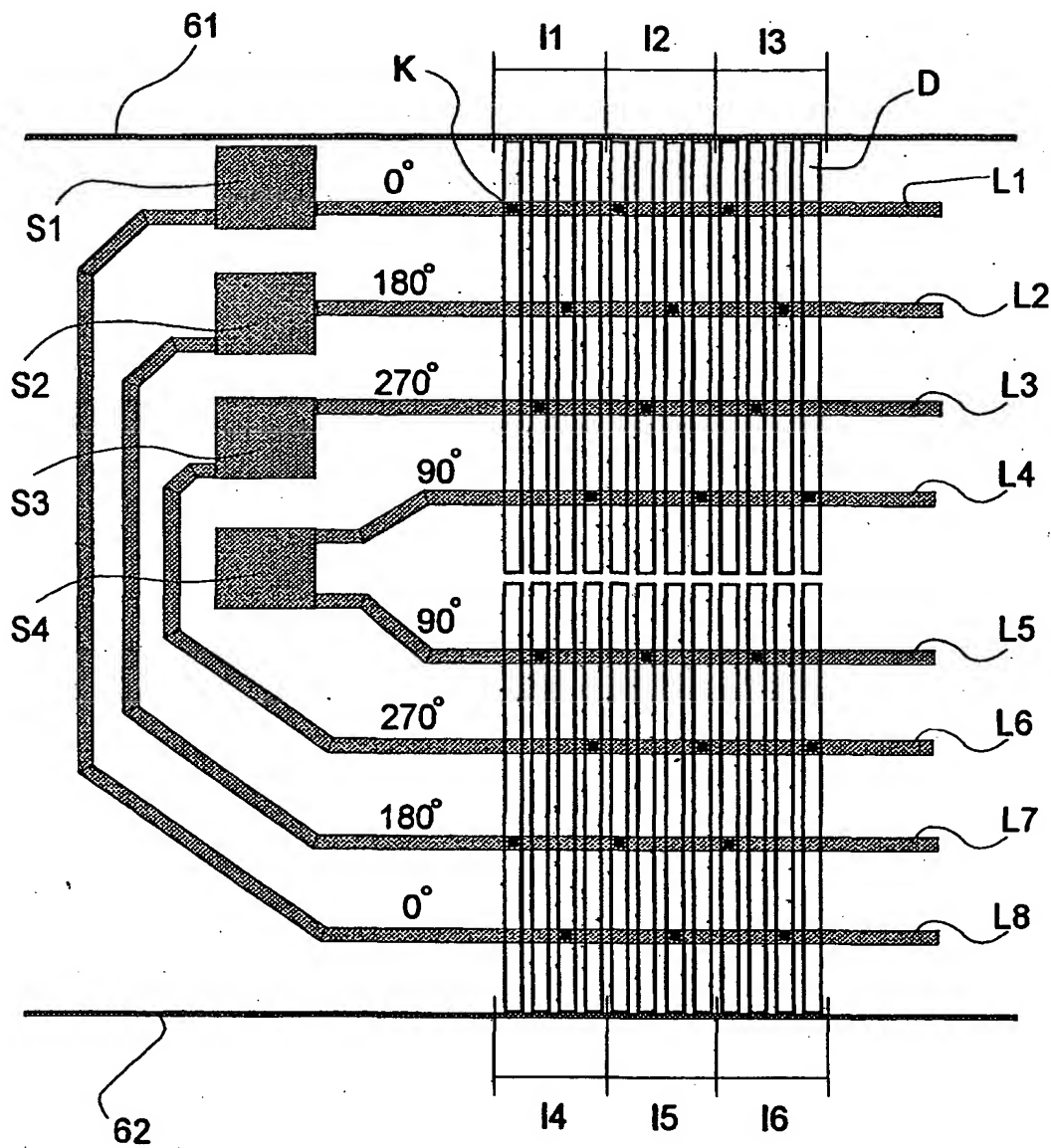


Fig. 5

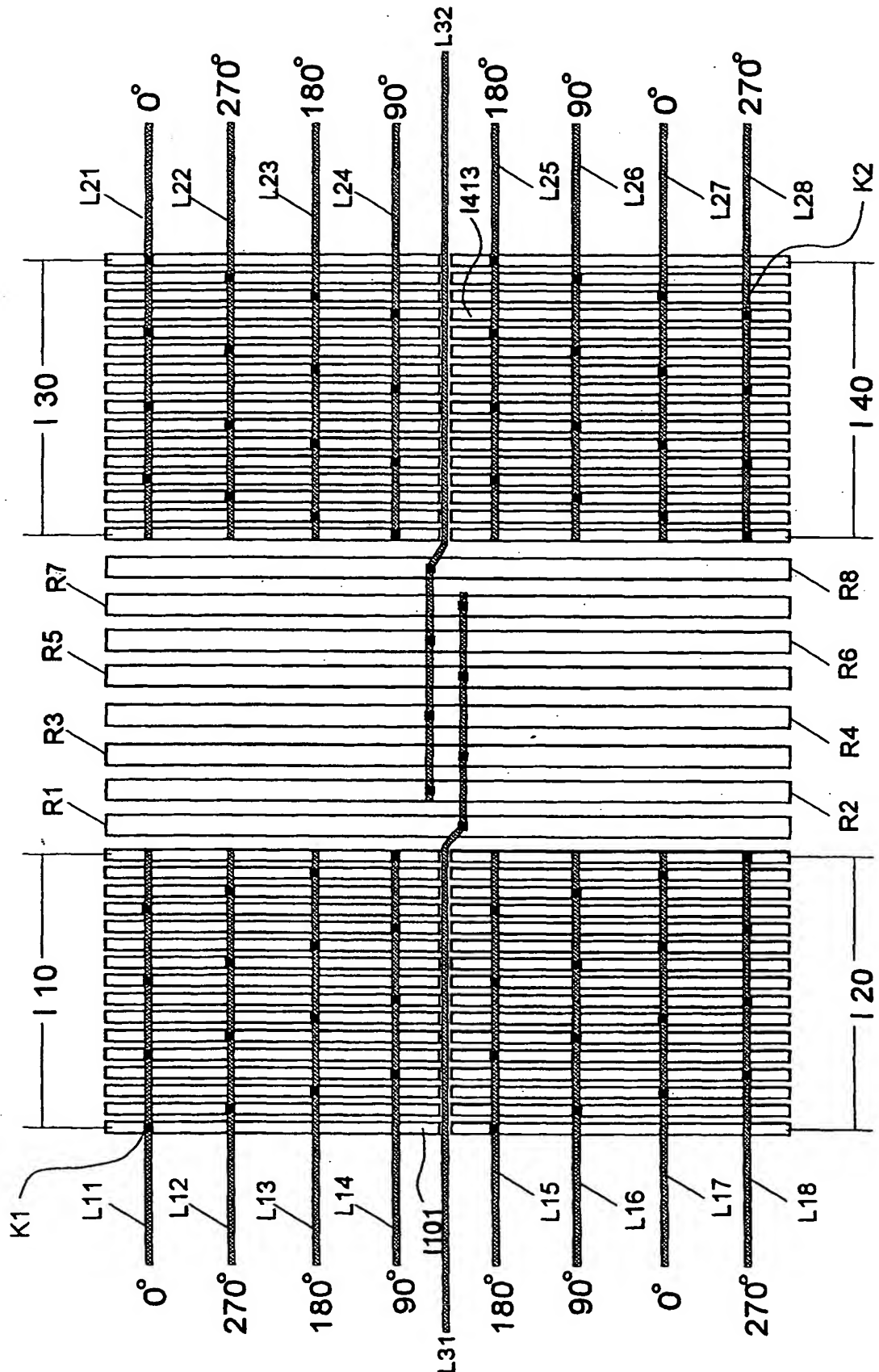
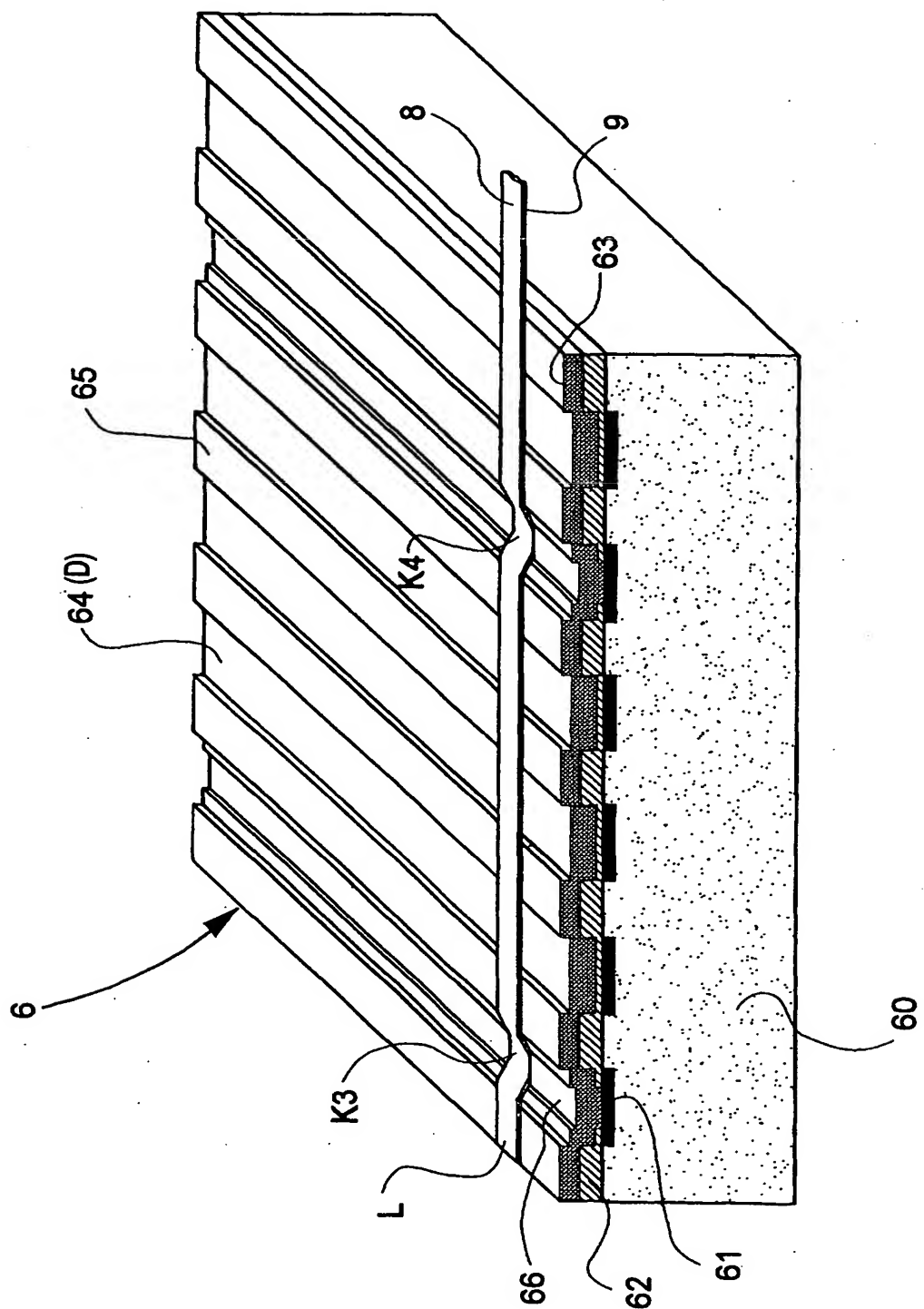


Fig. 6



THIS PAGE BLANK (USPTO)